

EVG Announces Mass Production Nanoimprint Equipment for 300mm Wafers / 2G Panels – June 20, 2021

EVG、300mmウェハ/2Gパネルに対応する量産対応ナノインプリント装置を発表

2021年06月21日14時13分 / 提供： [マイナビニュース](#) 



半導体製造装置メーカーであるオーストリアEV Groupは、ステップ&リピート・ナノインプリント・リソグラフィ(NIL)の新製品としてマスタースタンプ製造用「EVG 770 NT」を発表した。

同装置、ウェハレベル・オプティクス(WLO)、および高精度のラボ・オン・チップデバイス(マイクロ流体デバイス)、拡張現実(AR)ウェーブガイドなどの量産で使用される大面積マスタースタンプの製造を精緻な転写によって可能にしたものだという。

<https://www.mapion.co.jp/news/column/cobs2254840-1/>